

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成28年6月23日(2016.6.23)

【公表番号】特表2015-517676(P2015-517676A)

【公表日】平成27年6月22日(2015.6.22)

【年通号数】公開・登録公報2015-040

【出願番号】特願2015-514131(P2015-514131)

【国際特許分類】

**G 01 N 1/28 (2006.01)**

【F I】

G 01 N	1/28	F
G 01 N	1/28	G
G 01 N	1/28	H

【手続補正書】

【提出日】平成28年5月1日(2016.5.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0079

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0079】

上部ネック部分2112を排気するためにイオン・ポンプ2128が使用される。下室2126は、真空コントローラ2132の制御の下、ターボ分子および機械ポンピング・システム2130によって排気される。この真空システムは、下室2126に、約 $1 \times 10^{-7}$ トル(1.3× $10^{-7}$ ミリバール)から $5 \times 10^{-4}$ トル(6.7× $10^{-4}$ ミリバール)の間の真空を提供する。エッティング支援ガス、エッティング遅延ガスまたは付着前駆体ガスを使用する場合、室のバックグラウンド圧力は典型的には約 $1 \times 10^{-5}$ トル(1.3× $10^{-5}$ ミリバール)まで上昇することがある。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項8】

前記各動作が、人間の介入なしで自動的に実行される、請求項7に記載の方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項19

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項19】

厚さ100nm未満の薄片を自動的に製作する装置であって、  
イオン・ビーム・カラムと、  
加工物を支持するステージと、  
前記イオン・ビーム・カラムおよび前記ステージの動作を制御するコントローラであり  
、請求項1の各動作を実行するためのコンピュータ命令を記憶した記憶装置を含むコントローラと  
を備える装置。